(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

¹² 公開特許公報 (A)

昭57—100139

© Int. Cl.³
C 08 J 7/04
C 08 J 7/14
C 23 C 3/02

識別記号 102

1 0 1

庁内整理番号 7415—4F 7415—4F 7011—4K

③公開 昭和57年(1982)6月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈ポリアミド樹脂のメツキ方法

②特

願 昭55-176758

②出

願 昭55(1980)12月15日

⑫発 明 者 寺窪仁

横浜市旭区中希望ケ丘28― 2

⑪出 願 人 三菱レイヨン株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番19

号

⑪代 理 人 弁理士 吉沢敏夫

明 細 舊

/ 発明の名称

ポリアミド樹脂のメツキ方法。

2 特許請求の範囲

ポリアミド樹脂成形品を、塩酸水溶液で表面粗化するごとを特徴とする密着力のすぐれたポリアミド樹脂のメツキ方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はポリアミド樹脂成形品のメツキ方法に関する。

ポリアミド樹脂は各種の用途に用いられているが、メンキなどの表面装飾は困難で、良好なメンキ品は得られていない。

メツキ可能な解脂としては、ABS胸脂、ポリプロピレン、ポリフェニレンオキサイド、ポリオキシメチレンなどが知られているが、実用化されていると言えるのは、ABS樹脂のみである。

御脂にメッキする場合、メッキ胴に表面粗化

本発明者等は、ポリアミド樹脂をメツキする 際のエツチング万法について権々検討を行ない 本発明に到達した。

本発明におけるポリアミド樹脂とはポリカブ ロアミド(ナイロン6)、ポリヘキサメチレン アジボアミド(ナイロン66)等を指し、それ 5の樹脂が炭酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、 タルク、クレーなどの無機フイラー又はガラス 繊維などで充填補強された強化ポリアミド樹脂 も含まれるが、無機フイラーやガラス繊維等特 にタルク、ケイ酸カルシウム、クレーを 10~ よの重量を含むポリアミド樹脂に、本発明の方 法を適用すると特に密着力の面ですぐれたもの か得られる。

化学メッキには一般に金属塩、還元剤、 P H 調整剤などの成分よりなる公知の化学メッキ浴を使用することができる。 メッキ可能な金属としては、銅、ニッケル、銀、錫、コバルト及び錫ーコパルト合金などがあるが銅、ニッケルが液の安定性、密着性などからすぐれている。

次に行なう電気メッキは、銅、ニッケル、クロムなどの金属が可能であり、目的に応じて液成分、添加剤、及び襲厚を変えることができるような公知の電気メッキ浴を使用することができる。

本発明のメッキ方法によれば、塩酸水溶液によるエッチング工程でポリアミド樹脂表面が部分的に溶解されるため、表面に微細な凹凸か生じ、表面積の増大と微細な凹凸によるアンカー効果により密着のすぐれたメッキが可能になる。 又無水クロム酸硫酸のような樹脂表面全体の溶解ではなく、部分的な溶解のため光沢の良好なメッキ験が得られる。

下記実施例中、多は特に指示のないかぎり重

水分のためにメツキの密看力が低下することがあり、長時間の漫画は避けることが望ましい。 塩酸水溶液に漫漫後水洗し、次いで触媒賦与を 行なう。

触媒賦与をしたのち化学メッキを行なうが、

■きである。

実施例 /

東洋紡績株式会社製T-422(タルク充塡 ナイロンも樹脂)を用い、射出成形法により平 板を成形し供試材料とした。市販の脱脂板(エ ンソン社、エンブレート PC-452 609/8) にて、60℃、5分脱脂し、水洗した後、40 **じの塩飯 / 0 * 水溶板に 3 分浸漬しエツチング** を行つた。水洗の後、キヤタリスト板(奥野製 楽社、キャタリストA-30)に35℃、4分 浸慮し、触媒賦与を行つた。水洗後、硫酸10 容量を(機碗報/容量と水タ容量との混合物。 以下向じ)のアクセラレーター板に40℃、4 分浸價した。充分に水洗した後、化学ニッケル 液(奥野製薬社、TMP 化学ニッケル)に 3 s じ、ょ分間浸漬し化学ニッケルメッキを施した。 次いで硫酸銅 2 0 0 9/1 、硫酸 5 0 9/1 、光沢 削(ユージライト社、ユーバツクサ1)10g/l の叛組成の電気銅メツキ液に被温20℃でょ

A/am の電流密度で 6 0 分メッキを施し、約40 μの厚さに電析させた。得られたメッキ品を80 での熟風乾燥機で 2 時間熱処理した後、窒温ま で冷却し剝離強度を測定した。

実施例 2

アライド・ケミカル (株) 製 Capron CPN-/030 (ケイ酸カルシウム充填ナイロン 6 樹脂)の射 出成形平板を、実施例 / と同様に脱脂し水洗し た後 2 5 ℃の塩酸 / 2 5 % 水溶液に 5 分浸漬し エッチングを行つた。 その後の触媒賦与、 化学 メツキ、 電気メッキは実施例 / と同様に行つた。

実施例 3

Capron CPN-1030 を供試材料としエッチングは実施例 2 と同条件、同処理を行つた。次いで触媒賦与をセンシタイジングーアクチベーテイングの方法で行つた。即ち塩化第一編 1 0 9/8、塩酸 2 co/8 のセンシタイジング液化室温、2 分後渡し、水洗した後に、塩化パラジウ

賦与の方法をセンシタイシング・アクチベーテイング方法で実施例3と同様に行つた。その他の条件は実施例5と同様に行つた。

比較例 /、

東洋紡績(株) エーチ22 を射出成形法により 平板を成形し供は材料とし、60℃、よ分間脱脂し、水洗した。エツチングは無水クロム酸 チ009/8、硫酸20容量 */ 8 のクロム酸酸 エツチング液で行い、室温、13分間のクロム酸酸 を性虫硫酸ソーダで大価クロスを三個クロムに 変元し、充分に水洗した。水洗後に、塩酸に行った。 に室温、1分浸漬した。水洗後に行った。 に室温、1分浸漬した。水洗後に行った。 に室温、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗後に行った。 に変し、1分浸漬した。水洗りにでこり、 が起こり、電気鯯メッキ及び剝離できなかった。

比較例 2

比較例!と同材料を用い、エツチング条件も

ム 0.2 g/l 、塩酸 2 cc/l のアクチベーテイング 板に緊温、 3 分浸蛋した。化学ニッケルメッキ、 電気網メッキは実施例 1 と同様にして施した。

実施例 4

サーモフイル (株) N-40FM (ガラス繊維、ケイ酸カルシウム充填ナイロン 6) を供試材料として、エツチングは 40℃の塩酸 10% 水溶液で 5分 施した。その他の条件は実施例 1と同様に行つた。

実施例 5

モンサント (株) Vydyne RP-260 (クレー 充填ナイロン66)の射出成形平板を実施例 / と同様に脱脂した後、塩蟹 / 5% 水溶液を用い、 40℃で 5分 エツチングした。その他の条件は 実 施例 / と同様に行つた。

実施例 6

Vydyn● RP-260 を供試材料として、触媒

同じにし、大価クロムを選元し、充分に水洗した。残留クロムの除去は / 0 容量 > 塩酸に窒温、 / 分、 / 0 富量 > 苗性ソーダに窒温、 / 分、 更にまた / 0 容量 > 塩酸に窒温、 / 分浸漬することによつて行つた。 次いで触媒賦与、 メッキは実施例 / に従つて施した。 この場合比較例 / の如き化学ニッケルの析出ムラは発生しなかつた。か密着強度は低かつた。

比較例 3

モンサント Vydyne RP-260 を供試材料とし、60℃、5分間脱脂した後に、無水クロム酸/ 硫酸か 1000/0,400/20,300/43,20/60 (9/8) (容量 */8) の 畿度の各エツチング級に室温、5分浸漬しエツチングした。次いで比較例 2 に従い、残留クロム除去、触媒賦与、メツキを施した。

比較例 4

Vydyne RP-260 を、4009/0無水クロ

ム酸、20容量を/ℓ 硫酸のエツチング液で室温、3分エヺチングした。残留クロムの除去を行った後に触媒賦与を実施例3に従いセンシタイジング・アクチベ・テイングの方法で行い、メッキを施した。/

実施例 / ~ 6 及び比較例 2 ~ 4 の密滑強度を第 / 表に示した。無水クロム酸硫酸エツテングでは酸媒臓与の方法の如何に拘らず密滑強度が低いか、本発明に従つてメッキした時には、未強化及び強化ポリアミド樹脂共に約 / 匆/cd の 密着強度を発現した。

第 / 表

	実 施 例						比較		191
	,	2	3	4	5	6	2	3	#
磁着強度 (場/cm)	0.8	0.8	0.8	10	1.0	09	0.2	0.1~	0.2

DERWENT-ACC-NO: 1982-62798E

DERWENT-WEEK: 198230

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Plating process for polyamide resin mouldings involves

dipping in aq. hydrochloric acid soln. at specified temp. to

effect surface roughening

INVENTOR: TERAKUBO H

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI RAYON CO LTD[MITR]

PRIORITY-DATA: 1980JP-176758 (December 15, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 57100139 A June 22, 1982 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 57100139A N/A 1980JP-176758 December 15,

1980

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP C23C18/24 20060101 CIPS C08J7/04 20060101 CIPS C08J7/14 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 57100139 A

BASIC-ABSTRACT:

Polyamide resin moulding prod. to be plated is dipped in 3-50, pref. 5-25 wt.% aq. soln. of hydrochloric acid at 20-70 deg.C for surface roughening. After washing with water and application of catalyst, the moulding product is plated chemically and electrically.

The polyamide resin includes polycapramide, polyhexamethylene adipamide, etc. which may contain 10-50 wt.% of inorganic filler, esp. talc, Ca silicate and clay or glass fibre. When the moulding prod. is contaminated with release agent, grease, etc. it should be degreased prior to the treatment with organic solvent such as methylethylketone and acetone or surface active agent. The catalyst is applied by sensitisation/activation or catalyst/accelerator method.

The moulding prod. shows improved adhesion of plating, for the etched surface has good anchoring effect.

TITLE-TERMS: PLATE PROCESS POLYAMIDE RESIN MOULD DIP AQUEOUS

HYDROCHLORIC ACID SOLUTION SPECIFIED TEMPERATURE EFFECT SURFACE ROUGH

DERWENT-CLASS: A23 A35 M13

CPI-CODES: A05-F01D; A11-C04B; A11-C04D; M11-B05; M13-B;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0013 0037 0060 0205 0229 1283 1450 1723 1804 2211

2214 2218 2481 2483 2498 2500 2545 2661 3174 3252

Multipunch Codes: 028 03- 06- 075 141 15- 155 157 160 18- 192 193 206 207

229 308 309 310 441 466 470 471 476 54& 575 597 600

602 688 721